

## REPORT II

# 製造業の「国内回帰」現象の裏にあるもの

- 無差別な国内回帰でなく立地最適化の結果 -

社会研究部門 百嶋 徹  
hyaku@nli-research.co.jp

昨年春までは、「世界の工場」としての中国の台頭により、日本の製造業の空洞化が一層進展するとの論調が根強かったが、昨夏以降は国内の設備投資回復に合わせて一転、製造業の「国内回帰」が定説のようにもてはやされるようになった。

「国内回帰」という言葉の意味を文字通りに解釈すると、「海外移転した生産拠点が現地での事業の失敗や国内立地の優位性の再評価などを経て、再び国内に戻ってきた」ということになるが、実態はどうだろうか。本稿では、製造業の内外での設備投資データや最近の国内の個別投資事例などを分析することにより、「国内回帰」の動きを再検討するとともに、企業経営面における課題を抽出することにしたい。

### 1. 「空洞化」と「国内回帰」は本当か？

(1) 製造業全体では「空洞化」していない

そもそも「国内回帰」の前段階として「産業空洞化」がどれほど進展していたのだろうか。

ここでは、名目国内総生産（GDP）を用いた簡易な分析により、製造業全体での空洞化を検証しておく。2002年の製造業の名目GDPは90年に比べて12.8%減少したが、これを要因分解すると需要量要因（実質GDP要因）が6.5%増、

単位当たりマージン要因（デフレーター要因）が18.1%減であった。すなわち製造業のGDP減少は製品マージン悪化が主因であって、生産水準は拡大しており、GDP統計からは製造業全体での空洞化の顕著な傾向は見られない。

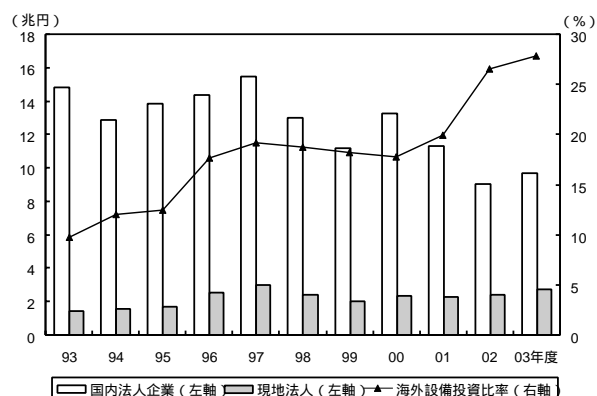
(2) 海外からの「回帰」は見られない

### 内外の設備投資比較

次に経済産業省「海外事業活動基本調査」と財務省「法人企業統計」のデータを接続して、製造業の設備投資活動が海外から国内へ回帰してきているのか検証してみたい。

製造業の海外現地法人（日本側出資比率10%以上）<sup>注1)</sup>の設備投資は2001年度を底に回復し

図表 - 1 製造業の現地法人と国内全法人の設備投資比較

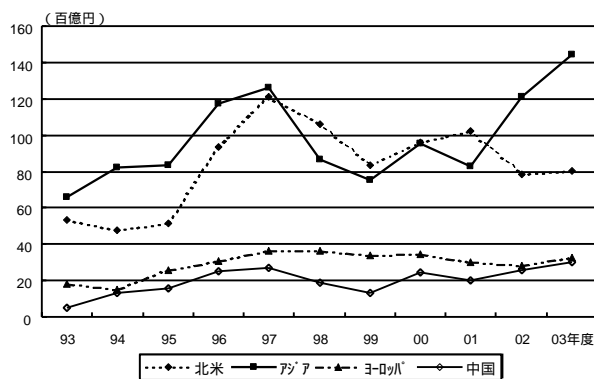


(資料) 経済産業省「海外事業活動基本調査」、財務省「法人企業統計」からニッセイ基礎研究所作成。

ており、2003年度（見込み）は2.7兆円と、過去最高を記録した97年度（約3兆円）の9割の水準まで回復している（図表 - 1）

一方、国内法人の設備投資は下降傾向にあり、2003年度は9.7兆円と前年比7%増と増加に転じたものの、直近のピークである97年度の6割の水準にとどまった。この結果、国内の設備投資に対する海外の設備投資の比率（海外設備投資比率）は上昇傾向にあり、2003年度は28%と過去最高を更新する見込みである。また海外設備投資を地域別にみると、NIEs、中国などアジアでの回復が顕著であり、2003年度に97年度の過去最高水準を唯一更新する見込みである（図表 - 2）。製造業全体で2003年度までの統計を見る限り、海外設備投資の相対的な位置付けは高まっており、設備投資の「国内回帰」の傾向はみられない。

図表 - 2 製造業現地法人の地域別設備投資の推移



(注) 中国はアジアの内数。

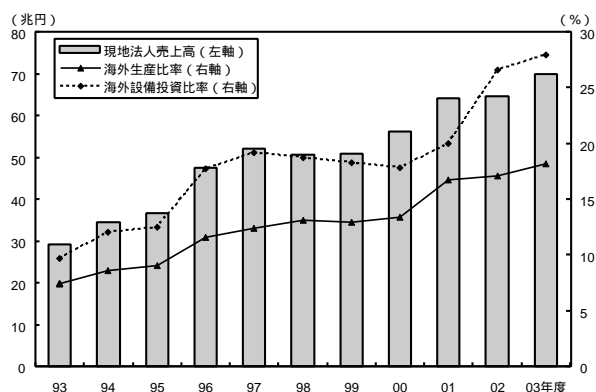
(資料) 経済産業省「海外事業活動基本調査」からニッセイ基礎研究所作成。

因みに、日本政策投資銀行の設備投資計画調査（2004年6月）によれば、製造業643社の2004年度の海外設備投資（連結ベース）は約1.7兆円と前年比8%増加する計画である。同一企業群の国内設備投資も17%増加する見込みだが、国内生産拠点を強化する代わりに海外拠点を縮小する戦略はとられていないとみられる。

## 売上高と経常利益の内外比較

海外設備投資の相対的な位置付けが高まっていることを受けて、設備投資の成果としての収益面でも海外現地法人のウェイトが高まっている。製造業全体の海外生産比率（現地法人売上高合計を国内法人売上高合計で除した値）は、国内売上高が横ばいのなか、アジアや北米の現地法人の売上高が順調に拡大しているため、上昇傾向にあり2003年度は18%と過去最高水準の更新が続いている（図表 - 3）

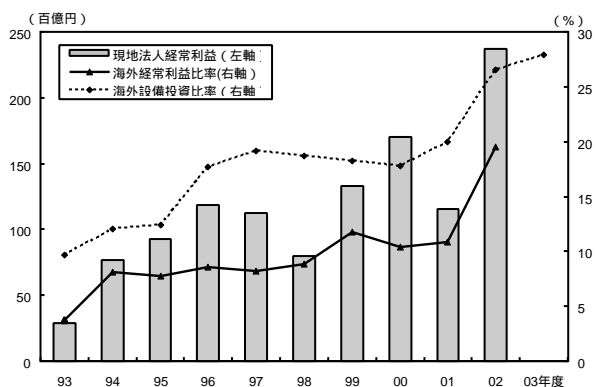
図表 - 3 製造業現地法人の売上高と海外生産比率、海外設備投資比率の推移



(資料) 図表 - 1 と同様。

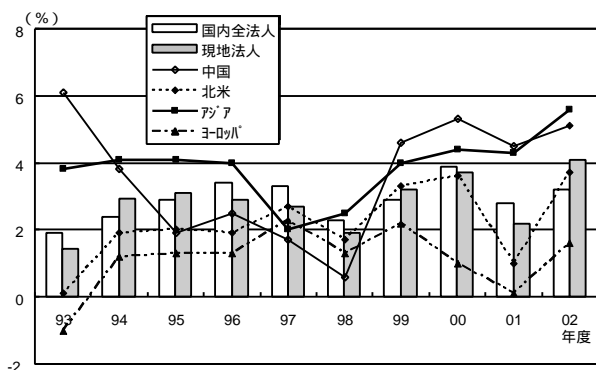
さらに損益面をみると、製造業の現地法人の経常利益は循環変動しながらも、アジアや北米を中心に増益基調にあるため、海外経常利益比率（現地法人経常利益 ÷ 同国内法人）も上昇傾向

図表 - 4 製造業現地法人の経常利益と海外経常利益比率、海外設備投資比率の推移



(資料) 図表 - 1 と同様。

図表 - 5 製造業の地域別現地法人と国内全法人の売上高経常利益率の比較



(資料) 図表 - 1 と同様。

向にあり2003年度は20%に達した(図表 - 4)。また売上高経常利益率でみた現地法人の収益性は、国内と遜色のない水準にあり、とくに中国などアジアの現地法人の利益率は99年以降国内を大幅に上回っている(図表 - 5)。欧州事業は低収益が続いており、今後再構築の可能性もあるが、製造業全体でみると収益面から海外生産を縮小して国内生産を拡充していく誘因は見当たらない。

製造業全体の現地法人の国内法人に対する比率は、設備投資、売上高、損益のいずれをとっても上昇基調にあり、海外生産拠点の相対的な位置付けは高まっており、これらの指標からは「国内回帰」の傾向はみられなかった。ただし、いずれの指標も直近で20~30%であることから、製造業全体では依然として国内の生産拠点を中心とした事業活動が行われており、「空洞化」が急激に進展しているわけでもない(注2)。

## 2. 最近の国内での工場建設事例の分析

### (1) デジタル家電関連に集中する大型案件

公表されている国内での大型の設備投資事例は、大型薄型テレビ、DVDレコーダー、デジタルカメラなどのデジタル家電に関連した案件が多いとみられる(図表 - 6)。家電メーカー

による最終製品だけでなく、部品、材料、工作機械・製造装置まで幅広い関連産業に波及している。ここではデジタル関連製品の事例に絞って議論を進めることにする。

とくに設備集約型産業である半導体や薄型パネル(液晶、プラズマ)の案件では、累計投資額が1,000億円~5,000億円に達する事例もみられる。東芝、富士通、エルピーダメモリなど半導体大手では、シリコンウェハー(半導体基板材料)の大口径化と加工線幅の微細化といったプロセス技術の世代交代に対応した大型投資が行われている面がある。また薄型パネルでは、シャープや松下電器産業は大型薄型テレビまでの一貫生産を図る方針である。

### (2) 国内での工場建設の背景

2003年以降、計画の打ち出しを含め国内での工場建設が相次いでいる背景はどこにあるだろうか。まずデジタル家電が牽引するデジタル景気を受けた循環的要因が挙げられる。従って、足下ではデジタルカメラ、携帯電話端末、大型液晶テレビなどの需要に減速感が強まり、また液晶パネル市況が韓国や台湾での大幅な増産により急落するなど、デジタル景気が下降局面を迎えつつあるため、2005年以降の国内での設備投資は一転減少する可能性がある。

循環的側面に加え、国内立地の優位性を再評価する構造的要因もあると思われる。すなわち

日本メーカーが競争優位にあるデジタル家電では、材料・部品などでも高い技術力を有する企業群が国内に集積しており、先端製品での産業集積力をフル活用でき、工場の早期立ち上げに有利であること、日本企業が強みとする製造技術のノウハウの海外流出を回避するためのブラックボックス化の推進、技術進歩への対応には開発と生産の一体化が必要であること、

図表 - 6 デジタル関連製品の最近の大型投資事例（2003年度以降）

事業分野	企業名	事業所名	所在地	事業内容	投資額（億円）	工期
半導体	東芝	大分工場	大分県大分市	300ミリアンペア対応システムLSI生産ライン	2,000	2003年6月～2007年度
		四日市工場	三重県四日市市	300ミリアンペア対応フラッシュメモリ生産ライン	2,700	2003年～2006年
	ルネサステクノロジ	トレセンティテクノロジーズ	茨城県ひたちなか市	300ミリアンペア対応量産ライン増設	700	2003年度
	NECエレクトロニクス	NEC山形	山形県鶴岡市	300ミリアンペア対応システムLSI生産ライン	650	2003年暮れ～2004年内
	富士通	三重工場	三重県桑名郡	300ミリアンペア対応DPAI LSI生産ライン	1,600	2004～2007年度
	エルピーダメモリ	広島エルピーダメモリ	広島県東広島市	300ミリアンペア対応DRAM工場（第一棟）増設	1,050	2003～2004年度
				300ミリアンペア対応DRAM工場（第二棟）	4,500～5,000	2004年6月より数年間
	松下電器産業	魚津工場	富山県魚津市	300ミリアンペア対応システムLSI生産ライン	1,300	2004年5月～2005年末
ソニー	ソニー・コンピュータエンタテインメントのSCE Fab2	長崎県諫早市	300ミリアンペア対応超高速プロセッサ生産ライン増設	530	2004年度	
薄型パネル	シャープ	亀山工場	三重県亀山市	大型液晶パネル（第6世代）、大型液晶テレビ	1,500	2002年9月～2005年春
		三重第3工場	三重県多気郡	システム液晶	920	2002年5月～2004年3月
	松下電器産業	松下プラズマディスプレイ	大阪府茨木市	プラズマディスプレイパネル（PDP）プラズマテレビ（第2工場）	600	2003年1月～2004年4月
			兵庫県尼崎市	PDP、プラズマテレビ（第3工場）	950	2004年9月～2005年11月
	富士通日立プラズマディスプレイ	宮崎事業所	宮崎県東諸県郡	PDP（新工場は三番館と呼称）	750	2005年初め～2007年
IPSアルファテクノロジー	日立ディスプレイテクノロジー	千葉県茂原市	薄型テレビ向け大型液晶パネル（第6世代）	1,100	～2008年度下期	
デジカメ	キヤノン	大分キヤノン	大分県大分市	デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ	150	2004年4月～2005年1月
太陽電池	三洋電機	二色の浜工場	大阪府貝塚市	太陽電池	128	2003年5月～2004年度中
材料	信越化学	信越半導体・白河工場	福島県西白河郡	300ミリアンペア増設	900	2003年度～2004年末
	富士写真フイルム	未定	熊本県菊池郡	液晶パネル用偏光板保護フィルム新工場	1,000超	～2010年

（注1）2002年着工の事例（シャープ・亀山工場および三重第3工場）を一部含む。

（注2）東芝・大分工場の投資額のうち420億円をソニーが負担。

（注3）トレセンティテクノロジーズはルネサステクノロジの生産子会社。

（注4）松下プラズマディスプレイは松下電器と東レの合弁会社。IPSアルファテクノロジーは日立製作所、東芝、松下電器の合弁会社。

（注5）シャープ・亀山工場は3期に分かれ第1期は2004年1月、第2期は同8月に稼働開始している。同・三重第3工場は2期に分かれ第1期は2003年6月に稼働開始している。

（注6）エルピーダメモリの第一棟増設の投資額は非公表。2003年度のキャッシュ・フロー計算書の有形固定資産取得と2004年度計画を加えて推定した。

（注7）着工時期が不明の場合、工期の開始時期を記載していない。

（資料）各社リリース資料等からニッセイ基礎研究所作成。

安価な労働力や電力費などが決定的な競争優位をもたらす事業でなく、設備集約型事業や研究開発集約型事業であれば、事業戦略次第で国内立地でも競争力を確保できること、地方自治体の企業誘致策の積極化、などが挙げられる。

事業特性を加味しながら、このような構造的側面を検討し、内外の立地比較を十分に行った

うえで国内立地を選択する企業は、国内立地ありきでなく、経済合理性に照らして立地最適化を図ったことに他ならない。立地最適化を徹底的に追求する企業戦略の下では、国内立地は選択肢の1つにすぎない。例えば、人件費がコスト競争力の決定的な要因であるような事業（汎用パレルの加工や家電の組立工程など）や電

力費が決定的要因となる事業(アルミ精練など)については、国内立地は明らかに選択されないだろう。定石通りだが、このような立地最適化戦略を実践できるかが重要なポイントである。

安易な国内立地一辺倒の戦略ではなく、経済合理性に基づいて内外の生産拠点のバランスをとっていく経営能力が求められる。国内立地によるブラックボックス化で生産ノウハウを守り続けられる保証がない限り、このようなバランス感覚は重要であろう。

### (3) 半導体、液晶、デジタルカメラの事例

国内での工場建設の大型案件の大半を占める半導体と液晶、さらに最終製品の代表事例としてデジタルカメラを取り上げてみたい。

#### 半導体

半導体業界では、90年代にNEC、日立製作所、東芝などの大手が日米半導体摩擦や顧客の海外展開への対応のため、中国、米国、シンガポールなどにDRAMを中心とする一貫工場を相次いで立ち上げた。しかし、その後の半導体不況を経て、いずれも撤退済みあるいは縮小過程にあると思われる。

現状では労働集約的な後工程(組立・検査工程)拠点がアジアなどで維持されているものの、製造プロセスの心臓部となる設備集約的な前工程(シリコンウェハーにIC回路を作り込む工程)の先端ラインへの投資は国内に集中している。このことから半導体工場は、海外工場の縮小・撤収を経て国内に回帰していると考えてよいだろうか。

そもそも海外展開を積極化していた時期でも国内拠点の維持・強化が図られ、国内中心の工場運営が行われていたこと、技術の世代交代に応じた製造プロセスの進化があるため、90年代と現在の生産ラインは全くの別物であるこ

とから、「国内回帰」という言葉は当たらない。因みに東芝が2002年にDRAM世界2位の米マイクロン・テクノロジーに売却した米子会社ドミニオン・セミコンダクタの当時の製造ラインでは、使用ウェハーの口径が200ミリメートル、加工線幅が175ナノメートル(nm、1nmは10億分の1メートル)であったが、現在の業界の先端ラインではウェハー口径300ミリ、線幅90nmのプロセスに移行している。

先端ラインの立上げにはプロセス技術者やオペレーターの高い熟練度を要する。また技術の世代交代とともに日本が強みを持つ部材・装置技術の重要性が高まっており、部材・装置メーカーとのコ・ワークが欠かせない。このようなことを勘案すると、日本の半導体メーカーが先端ラインを国内に立地させることは理に当たっているように思われる。ただし立地最適化を徹底追求する観点からは、例えば装置産業の投資回収にとって重要な税制の恩典や国民に対するIT(情報技術)教育の充実度など、政府の取り組みも重要なチェックポイントであり、より総合的な判断が求められる。

ここで半導体世界最大手である米インテルの工場立地を見てみよう(図表-7)。前工程ラインは合計13ラインあり、所在地別では米国9つ、アイルランド2つ、イスラエル2つとなっている。また300ミリウェハーおよび90nm以下のプロセスを用いた先端ラインは、計画を含め5つあり、うち4つが米国、1つがアイルランドである。米国立地が多いものの、アイルランドに先端の主力工場の1つを建設したことが注目される。アイルランドでは優れた労働力や税制の恩典を享受でき、また国を挙げてIT教育を含めIT競争力の強化に取り組んでいる。インテルは決して米国立地ありきとの発想ではなく、徹底した立地最適化を実践していると推測される。

図表 - 7 インテルの半導体前工程ラインの立地構成

国名	所在地	ライン名	設立年	製品	プロセス技術 (ナノメートル)	ウェル-口径 (ミクロメートル)	計画	
							内容	時期
米国	Hillsboro, Oregon	D1C	1999	ロジック	90	300		
		D1D	2003	ロジック	90	300	65ナノ	2005年
		Fab20	1996	ロジック	130	200		
	Rio Rancho, New Mexico	Fab11X	2002	ロジック	90	300		
	Chandler, Arizona	Fab12	1996	ロジック	180	200	300ミリ/65ナノ	2005年後半
		Fab22	2001	ロジック	130	200		
	Santa Clara, California	D2	1988	ロジック、フラッシュメモリ	130,180	200		
	Colorado Springs, Colorado	Fab23	2001	フラッシュメモリ	180	200		
Hudson, Massachusetts	Fab17	1994	ロジック	130	200			
アイルランド	Leixlip	Fab10/14	1993/1998	ロジック	180,250	200		
		Fab24	2004	ロジック	90	300		
イスラエル	Jerusalem	Fab8	1985	ロジック、フラッシュメモリ	350/500/700/1000	150		
	Qiryat Gat	Fab18	1999	ロジック	180	200		

(注) 網掛けは先端ラインを示す。

(資料) インテルH P等からニッセイ基礎研究所作成。

## 液晶

液晶は、これまで半導体以上に国内中心の立地構造にあったと考えられる。設備集約型の前半工程（薄膜トランジスタ形成、液晶注入など）は基本的に国内立地であり、後半工程（実装・モジュール組立工程）で家電メーカーの海外進出に合わせて、一部アジアなどに拠点を持つ展開であった。投入するガラス基板（マザーガラス）が世代ごとに大型化するにつれ製造技術の難易度が高まり、テレビ向けなど大型液晶の最新鋭工場は国内立地に限られる。

ただし最近では海外展開の動きも出てくるなど、横並びではない立地最適化の模索が始まったと思われる。東芝と松下電器の合併会社である東芝松下ディスプレイテクノロジーは、2002年よりシンガポールで第4世代と呼ばれるガラス基板を用いた前半工程ラインを操業している。因みにシンガポールは、国を挙げてIT、化学、バイオに絞って優れた企業誘致戦略を展開していることで有名である。

NECは中国企業との合併により、中国初の前工程からの一貫生産ライン（第5世代）の操業を今年開始した。また大型テレビ用パネルで出遅れていたソニーは、世界最大手の韓国サム

スン電子との合併により、世界初の第7世代生産ラインを2005年に韓国で量産稼働させる。

一方、国内首位のシャープは、世界初の第6世代大型パネル生産ラインを有する亀山工場（今年1月より稼働開始）を中心に中小型パネルの拠点も含め、工場立地を三重県に集中させている。ただし中小型液晶の後半工程については、携帯電話などセットメーカーの進出が進んでいる中国での生産を行う計画である。

## デジタルカメラ

デジタルカメラ（デジカメ）は、レンズ、撮像素子（CCD（電荷結合素子）など）、画像処理エンジン（デジカメを作動させるための機能を詰め込んだチップセット）、液晶、電池、外部メモリーなどの機能単位（モジュール）で構成され、基本的にモジュール部品の組立型産業である。

デジカメメーカーはカメラメーカーや電機メーカーであるため、各社得意とする部品を内製し、さらに競合企業に外販するケースもあるが、基本的に基幹部品の生産分業化が進んでいる。このためデジカメの製品差別化が難しくなる傾向にある。デジカメ部品は総じて技術難易度が

高く、日本企業が市場を押さえている。市場寡占度の高い基幹部品に付加価値が移転する傾向があるなか、製品価格の低下が進み、さらに足下では需要に減速感が強まってきたため、デジカメ事業自体での収益確保が難しくなりつつあると思われる。

このような業界環境の下で各社の工場立地戦略は極めて多様である。ここではキヤノン、三洋電機、富士写真フイルムの事例をみてみよう。

キヤノンは6割を国内、4割をマレーシア、中国、台湾で生産している。2002年からマレーシアで海外生産を開始した。大分県を中心とした生産体制を構築しており、今後も国内生産比率は60%を維持していく方針である。基幹部品ではレンズユニット、画像処理エンジン、画像センサーに強みを持ち、これらは国内で開発・生産されている。2005年に大分市で立ち上げる新工場は、カメラ部門の国内生産拠点である大分キヤノン（キヤノンの完全子会社）の第2工場にあたるものである（図表 - 6）。立地の背景としては、96年にデジカメの生産を開始した大分キヤノンの既設工場がマザー工場として大分県内にあり協力会社が形成され、電装品など周辺技術が集積していること、ロジスティックスのノウハウ蓄積があること、などが挙げられる。

三洋電機は年1,500万台の生産能力を持ち、その立地構成は国内13%、中国40%、インドネシア37%、韓国10%とアジア中心の生産体制となっている。生産のうち95%以上が他社へのOEM供給である。内製部品は強みを持つ電池、液晶に加え、半導体などである。高水準の海外生産比率は組立コストの競争力による面もあるが、事業の歴史的経緯も関係している。例えばビデオデッキなどアナログ系製品の工場から転換し、必ずしも新規立地ではないケースがある。

生産比率は少ないものの、国内工場は生産技術の革新や新機種の不具合確認などを担いマザー工場としての位置付けにあると思われる。

富士写真フイルムは6割を国内、4割を中国で生産している。レンズやCCDなど基幹部品の内製工場が国内に立地していたため、国内生産が中心となってきたが、直近での海外生産比率は従来の2割強から4割へと引き上げられた。基幹部品は液晶を除いてほぼ内製している。総合写真メーカーとして培ってきた画像処理技術に強みを持つ。

3社とも国内工場を高付加価値機種を生産するマザー工場と位置付ける一方、海外生産戦略は各社各様である。2003年度で見ると、海外生産比率は三洋電機80%、キヤノン40%、富士写真フイルム20%強に対して、生産量は三洋電機が1,110万台と1,000万台を突破し世界最大規模となり、キヤノン860万台、富士写真フイルム625万台であった。生産量の拡大とともに、普及モデルで人件費など安価な組立コストを海外生産に求める誘因が強くなる面もあるが、海外生産比率の格差は基本的に各社の工場立地戦略の違いを反映しているとみられる。3社の事例をみる限り、安易な国内回帰志向はみられず、国内立地の優位性や各社の独自性を活かしながら、グローバルな観点からの立地最適化を図っているように思われる。

### 3. 解決すべき経営課題

#### (1) 横並びの投資行動からの脱却

統計データの分析や電機産業の事例分析から、最近の国内での相次ぐ工場建設は「国内回帰」との言葉は当たらないと指摘した。だが経済合理性に照らして立地最適化を模索・追求する企業がある一方、立地最適化の十分な検討を行わずに「国内回帰ブーム」に乗って横並びの

投資を決定した企業もあるのではないだろうか。安易な国内立地志向による横並びの投資行動は国内に過剰生産能力を追加することにつながる。

日本の製造業の低収益構造は、需要増に合わせた先行投資が十分に行われず、競争力のある設備への更新が進まないことに起因する。老朽設備の蓄積が供給過剰と生産性低下を招いてきた。根底には長期ビジョンを欠く横並びの投資行動がある。

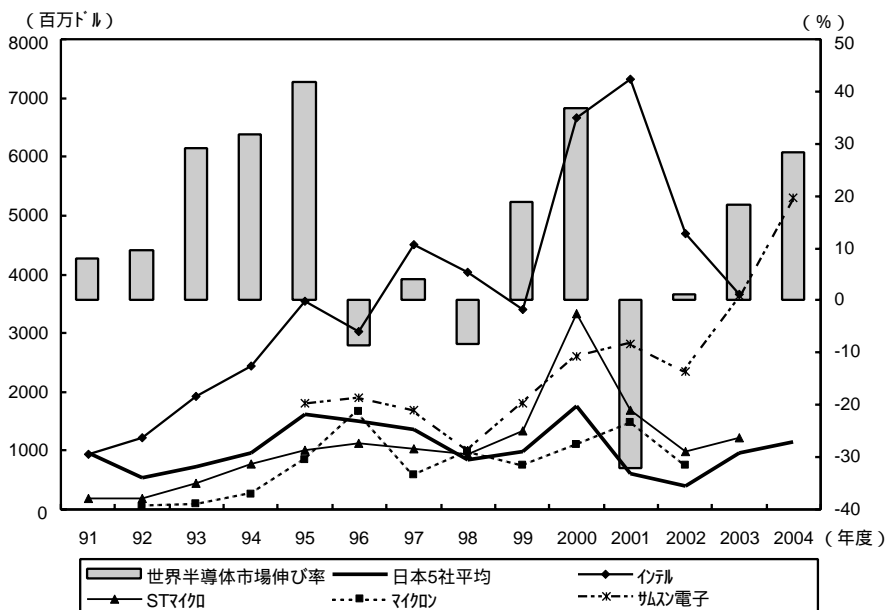
半導体産業を例にとろう。インテルやサムスン電子など海外勢は、各々が明確な戦略ビジョンを持ってタイムリーかつ十分な先行投資を行ってきたが、日本勢は個性を欠く不十分な先行投資により好況期での収益向上機会を逸し、財務体質の改善が進展せず、投資余力が低下する悪循環に陥ってきた（図表 - 8）

デジタル景気を受けて日本の半導体大手も、先端プロセスを用いた300ミリウェハー対応の

新ラインの国内投資計画を相次いで発表している（図表 - 6）。累計投資額が2,000～5,000億円に達する計画もあるものの、いずれも単年度での集中投資でなく複数年に分散した計画となっている。2004年度の設備投資計画は、サムスン電子が5,800億円程度に対して日本の大手5社は1社平均で1,250億円とサムスン電子の2割程度にすぎない（図表 - 8）。日本勢の新ライン計画のリリース資料には、決まり文句のように「需要を見極めながら段階的に投資を行う」とのコメントがあるが、半導体需要は漸次的ではなく大幅に変動するのが通常ではないだろうか。世界の半導体需要が過去20年間で1桁の変動率にとどまった年は4割にすぎない。

日本勢の先端ライン計画がタイミングを逃した横並びの投資となってしまわないだろうか。また日立製作所と三菱電機の合弁企業ルネサステクノロジから打ち出されていた、複数社による先端ラインへの共同投資構想が結局成立せ

図表 - 8 半導体の世界市場伸び率と世界大手メーカーの設備投資の関係



(注1) 世界半導体市場伸び率は右軸、それ以外は左軸。  
 (注2) 設備投資は日本5社平均およびサムスン電子は半導体部門、それ以外の企業は全社ベース。  
 (注3) 日本5社は2002年度まで東芝、NEC、日立製作所、富士通、三菱電機、2003年度以降は東芝、NECエレクトロニクス、ルネサステクノロジ、富士通、エルピーダメモリとした。  
 (注4) 換算レートは109円/ドル、137円/ユーロ、0.1円/ウォンを用いた。  
 (資料) プレスジャーナル「日本半導体年鑑」、アニュアル・レポート、各社ホームページ等からニッセイ基礎研究所作成。



ず、各社が個別で投資を行うことになったため、共同ライン構想が成立していたケースに比べ、業界全体で過剰投資となることも懸念される。

財務力の制約から分散投資となり投資タイミングを逃すのであれば、資本市場での資金調達により集中投資を実施すべきであろう。その際、経営側は投資の戦略的重要性を株主に納得させ、資金調達による発行済株式数の増加を上回る株主価値向上をコミットする必要がある。

## (2) 汎用分野で稼ぐ経営力

最近の国内投資案件は、高付加価値化を狙ったものが揃って多いが、本当にそれでよいのだろうか。ここでも半導体産業を例にとろう。

日本の半導体産業はアジア勢との価格競争を避けるため、パソコン用DRAMなど大量生産型汎用製品から縮小・撤退し、システムLSIなど多品種少量型の高付加価値製品へ転換する方向にある。今回の先端ラインへの投資計画もシステムLSIの増産を目的とするものが多い。だが「経営安定のためには高付加価値路線しかない」との横並びの発想になっていないだろうか。高付加価値戦略を採っても顧客に受容されなければ高収益を獲得できない。実際、システムLSIは多額の開発コストがかかる割に用途ごとの市場規模が小さく、現状では低収益にとどまっている。高付加価値製品と言ってもインテルのマイクロプロセッサ(MPU)や米テキサス・インスツルメンツのデジタルシグナルプロセッサ(DSP)のように、一定の市場規模がなければ高収益は確保できない。

逆に事業特性に応じた勝ち残り戦略を実行できれば、汎用製品にも復権のチャンスはありと考えられる。例えば汎用DRAMでは、タイムリーな設備投資を行えば好況期に大幅な収益向上を享受でき、一段の業界再編を経て個別半導

体(ディスクリート)のように残存者利益を確保できる時期もいずれ来るだろう。ディスクリート事業はシステムLSIと異なり仕様の標準化が進んでおり、複数のメーカーが同一仕様の製品を製造している場合も多い。汎用品で低価格ながら、日本勢が強みを持つ半導体パッケージ技術や生産工程の効率化などが奏功し、日本の半導体企業の収益源となっている。ディスクリート事業は、日本の製造業が汎用分野でも勝ち残っていくためのモデルケースとなる。

汎用製品は高付加価値製品との技術・生産面での相乗効果がある場合も多く、高付加価値分野とともに厳選された汎用製品を併せ持つことは国全体として重要だろう。米国ではインテルのように高付加価値製品を主力とする企業と、DRAMで世界第2位に躍進したマイクロ・テクノロジーのように汎用製品を主力とする企業に分かれている。

日本企業は明確な戦略ビジョンの下で、横並びの製品ポートフォリオ戦略や投資行動から脱却し、強みを活かした個性化戦略を打ち出すべきである。

## (3) 立地最適化の追求は定石経営

経済合理性に基づいて工場立地の最適化を追求していくことは、経営の基本に極めて忠実な「定石経営」と言える。

液晶パネルやデジカメの事例では、各社が横並びではない立地最適化の模索・追求を始め、多様化の動きが出てきたと思われる。一方、国内重視の工場立地戦略を採るシャープは、独自技術をベースに国内生産にこだわる方針を示して社内の技術者の意欲を鼓舞した。明確な経営思想への「共鳴の連鎖」が醸成されたのであり、これも「定石経営」と言えよう。

また日立製作所は今年10月に「新中国事業戦

略」を発表した。2004～2006年度に累計10億ドル以上を投資し、中国での現地生産高を2003年度の31億ドルから2006年度に70億ドルへと倍増させる意欲的な計画である。「中国企業としての日立」の実現を目指し、重電、社会インフラ、医療、情報通信、自動車部品、デジタル家電関連製品といった幅広い事業領域をカバーする総合力をフル活用していく方針である。

素材産業では、84年にシンガポールで石油化学コンビナート事業の操業を開始し、成長するアジア市場をいち早く取り込んできた住友化学が、安価原料の安定的確保のためにサウジアラビアで国営石油会社サウジ・アラムコとの合併により、石油精製からの一貫石油化学コンビナートを2008年後半に操業開始する計画である。投資額は約43億ドルと見込まれている。

このように一部の企業では立地最適化に向けた独自の動きを本格化させつつある。製造業の「国内回帰」現象のように見える部分は、グローバルな見地から見ても日本における工場立地が最適と判断される結果がいくつか出てきたということを物語るものである。日本の製造業は世界市場での勝ち残りに向けて、工場立地の最適化を定石通りに追求していくことが求められている。

-----  
(注1) 「海外事業活動基本調査」(2003年調査)の集計対象企業数は本社企業2,166社(うち製造業1,444社)、現地法人13,322社(同6,918社)、回収率は64.8%。ただし現地法人の設備投資、売上高、経常利益についての回答企業数は不明。

(注2) 業種別にみると、輸送機械(船舶製造・修理を含む)が海外設備投資比率59%(2003年度)、海外生産比率48%(同)、海外経常利益比率40%(2002年度)と突出して海外依存度が高い。電気機械は海外設備投資比率25%、海外生産比率28%、海外経常利益比率24%と輸送機械に比べ国内中心の事業活動となっている。